

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成24年1月19日(2012.1.19)

【公開番号】特開2010-138433(P2010-138433A)

【公開日】平成22年6月24日(2010.6.24)

【年通号数】公開・登録公報2010-025

【出願番号】特願2008-314219(P2008-314219)

【国際特許分類】

C 25 D 21/12 (2006.01)

C 25 D 7/12 (2006.01)

C 25 D 17/00 (2006.01)

C 25 D 21/00 (2006.01)

【F I】

C 25 D 21/12 A

C 25 D 7/12

C 25 D 17/00 B

C 25 D 21/00 K

【手続補正書】

【提出日】平成23年11月25日(2011.11.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

カソードを有する基板を保持可能な基板保持部と、
前記カソードの周辺部に電力を供給する給電部と、
前記カソードと対向する位置に設けられたアノードと、
前記カソードと前記アノードとの間に設けられた複数の誘電体と
を具備し、

前記複数の誘電体は、前記カソード表面に平行な平面に前記複数の誘電体を射影したとき、前記射影のパターンが前記平面内で略均一であり、前記射影の面積が可変であるように構成されている

半導体装置製造装置。

【請求項2】

請求項1に記載の半導体装置製造装置において、
前記給電部へ流される電流の積算電流量をモニタするモニタ部と、
前記積算電流量に応じて前記複数の誘電体を動作させて、前記射影の面積を制御するコントロール部と
を更に具備する
半導体装置製造装置。